

Title (en)

Process for the regeneration of direct image offset printing forms.

Title (de)

Verfahren zur Regenerierung von vorzugsweise vorher direkt bebilderten, für den Offsetdruck geeigneten Druckformen.

Title (fr)

Procédé pour la régénération de formes d'impression offset avec image directe.

Publication

**EP 0523584 A1 19930120 (DE)**

Application

**EP 92111869 A 19920713**

Priority

DE 4123959 A 19910719

Abstract (en)

According to a process for repeated reversible regeneration of preferably direct-imaged offset printing forms, which process comprises removing the image on the printing form and hydrophilising the surface of the printing form, an ionised process gas is applied to the printing form by means of a charging device, reactive deletion of the image and simultaneous hydrophilisation being carried out in a single process step. The volatile reaction products thus formed are removed by means of a suction device. <IMAGE>

Abstract (de)

Nach einem Verfahren zur wiederholten, reversiblen Regenerierung von vorzugsweise vorher direkt bebilderten, für den Offsetdruck geeigneten Druckformen, das die Entfernung der Bebilderung auf der Druckform und eine Hydrophilierung der Oberfläche der Druckform umfaßt, wird auf die Druckform ein ionisiertes Prozeßgas mittels einer Beaufschlagungsvorrichtung gebracht, wobei ein reaktives Löschen der Bebilderung und die gleichzeitige Hydrophilierung in einem Prozeßschritt vorgenommen wird. Die dabei entstehenden flüchtigen Reaktionsprodukte werden mittels einer Absaugvorrichtung abgeführt. <IMAGE>

IPC 1-7

**B41C 1/10**; **B41N 3/00**

IPC 8 full level

**B41C 1/00** (2006.01); **B41C 1/10** (2006.01); **B41N 3/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B41C 1/1075** (2013.01 - EP US); **B41N 3/006** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] DE 3713801 A1 19881110 - FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUER DR [DE]
- [Y] US 4777109 A 19881011 - GUMBINNER ROBERT [US], et al
- [Y] SHUZO FUJIMURA, ET AL.: "RESIST STRIPPING IN AN O<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O PLASMA DOWNSTREAM.", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, AVS / AIP, MELVILLE, NEW YORK, NY., US, vol. 09., no. 02., 1 March 1991 (1991-03-01), US, pages 357 - 361., XP000266430, ISSN: 1071-1023, DOI: 10.1116/1.585575

Cited by

US5826511A; US6006666A; EP0693371A1; US5816161A; US6016750A; US6125756A; EP0570879B1; EP1080942B2

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0523584 A1 19930120**; **EP 0523584 B1 19950823**; CA 2071773 A1 19930120; CA 2071773 C 19960917; DE 4123959 C1 19930204; DE 59203363 D1 19950928; JP 3217464 B2 20011009; JP H05193086 A 19930803; US 5317970 A 19940607

DOCDB simple family (application)

**EP 92111869 A 19920713**; CA 2071773 A 19920622; DE 4123959 A 19910719; DE 59203363 T 19920713; JP 18911892 A 19920716; US 89933792 A 19920616